

「原子層沉積與蝕刻技術」研討會

說明：無論在積體電路或光電元件，此些前瞻應用日新月異，尺寸亦日漸微型。這其中如何提供此類元件適當之保護層，或成長適當之超薄功能性薄膜，甚至反向超薄之蝕刻技術，原子層沉積與蝕刻居可版演一重要之角色。本研討會將從市場需求，元件設計與應用，提供關注前瞻製程設備與技術在未來微電子/光電產業角色之產業專家討論之平台。

參加對象：此產業有興趣者

費用：課程原價 3,000 元；學會會員優惠價 1,800 元。

人數：以 60 位為限，額滿截止報名。

主辦單位：台灣真空學會(TVS)、台灣電子設備協會(TEEIA)

地點：台北市南港展覽館 502 會議室

Venue：Room 502, TWTC Nangang Exhibition Hall

日期 Date：	2018/08/29 (星期三)	
時間 Time	主題 Topic	講師 Speaker
12:30~12:50	報到	
12:50~13:00	學會致歡迎詞	台灣真空學會 洪瑞華 理事長
13:00~13:40	原子層蝕刻技術發展 Development of atomic layer etching technique	國家實驗研究院儀器科技研究中心 蕭健男 研究員
13:40~14:20	鍺奈米線的製造 Ge NW-FET fabrication	國研院奈米中心 李耀仁 博士
	休息/交流	
14:30~15:10	原子層沉積技術的工業應用趨勢	原晶半導體設備股份有限公司 林宜鋒 副總經理
15:10~15:50	原子層沉積系統在光電元件之應用 Application of atomic layer deposition system in optoelectronic devices	台灣真空學會 洪瑞華 理事長
15:50~16:30	原子層沉積技術於低溫 III 族氮化物磊晶之應用 Applications of atomic layer deposition on low-temperature III-nitride epitaxy	國立台灣大學材料科學與工程學系 陳敏璋 教授

◎ 報名聯絡資訊

1. 聯絡人：台灣真空學會-秘書曹櫻歷小姐 洽詢電話：03-579-5046

2. 電子信箱：taiwanvacuum@taiwanvacuum.org 學會網頁：<http://www.taiwanvacuum.org>

【若遇不可預測之突發因素，本學會保有此辦法內容調整及變動權】